# **EUROPĘAN PATENT OFFICE**

# **Patent Abstracts of Japan**

PUBLICATION NUMBER

62242378

**PUBLICATION DATE** 

22-10-87

APPLICATION DATE

14-04-86

APPLICATION NUMBER

61085722

人性的复数 网络一种人工作的

APPLICANT: KOMATSU LTD;

INVENTOR :

YAMAGUCHI TADAYOSHI;

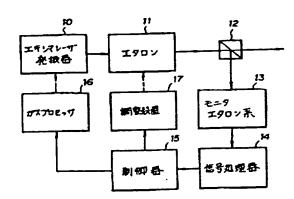
INT.CL.

H01S 3/102 H01S 3/094 H01S 3/105

TITLE

**CONTROLLING METHOD FOR** 

WAVELENGTH OF LASER LIGHT



ABSTRACT :

PURPOSE: To control the wavelength of a laser light beam without using a spectroscope by making part of oscillated laser light beams fall on an optical means of forming interference fringes, and by changing the wavelength of the oscillated laser light beams so that the position of the interference fringes be coincident with a position relevant to a target wavelength.

CONSTITUTION: An excimer laser oscillator 10 oscillates laser light beams having a wavelength of an ultraviolet area, and an etalon, one of wavelength selecting means, allows only laser light beams of specified wavelength to pass through, while a beam splitter 12 splits incident laser light beams, leading one of them to a main use and the other to a monitor etalon system 13. Interference fringes are formed on a detecting plane, and a line image sensor 13c supplies a signal processor 14 with informations on the position and intervals of these interference fringes. The signal processor 14 compares a found wavelength with a target wavelength and delivers a control signal to a controller 15 so as to make the oscillated wavelength coincide with the target wavelength. The controller 15 gives a control to a gas processor 16 or an adjusting unit 17 or to both of them.

COPYRIGHT: (C)1987, JPO& Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 242378

௵Int.Cl.⁴ H 01 S 3/102 3/094 3/105 庁内整理番号 7630-5F 7630-5F

7630-5F

母公開 昭和62年(1987)10月22日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 レーザ光の波長制御方法

②特 願 昭61-85722

願 昭61(1986)4月14日

特許法第30条第1項適用 昭和60年12月20日 社団法人発明協会発行の発明協会公開技報により発表

平塚市高村203-14-406 康 梶 ⑫発 明者 Ш 鏧 平塚市万田18 砂発 明 者 斉 藤 平塚市万田18 夫 板 倉 砂発 明 平塚市万田18 理 林 明 若 砂発 平塚市万田18 雅 彦 729発 明 者

識別記号

忠 粪 砂発 眀 者 Щ ⑪出 願 人 株式会社小松製作所

平塚市北金目1214-7

砂代 理 弁理士 木村 高久 東京都港区赤坂2丁目3番6号

#### 1. 発明の名称

レーザ光の放長制御方法

#### 2. 特許請求の範囲

発振レーザ光の一部を、誌レーザ光の皮長に対 応した位置に干渉縞を形成する光学手段に入射さ せ、前記干渉稿の位置が目標放長に関連した位置 と一致するように前配発掘レーザ光の放長を変更 する手段を制御することを特徴とするレーザ光の 被長制御方法。

### 3. 発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明はレーザ光の液長制御方法に関する。

#### 〔従来の技術〕

従来、レーザ光の放長を知るためには、第5図 に示すようにレーザ光原1から出射したレーザ先 をレンズ・フィルタ等の前処理系2で加工し、分

(1)

光器3に適した光として分光器3の入射スリット 3 a に導入し、分光器 3 中の回折格子 4 b 、 3 c (あるいはプリズム)と回転ステージにより決め られた方向へ光を導き、出射スリット3 d から光 が出てきた時を信号処理器4で検知し、このとき の回転ステージの角度(回転ステージの角度と放 長との関係は予め検定されている)からレーザ先 の放長を検知する。

したがって、レーザ光の故長を所定の彼長とな るように制御する場合には、予め所領の被長のレ ーザ光が入射するとき、出射スリット3dから光 が出るように回伝ステージの角度を調整しておき、 レーザ光が前記出射スリット3dから出るように そのレーザ光の波長を放長選択手段(例えば調整 可能なエタロン)などによって何定する。

### [発明が解決しようとする問題点]

しかし、分光器を用いて放長を同定する場合、 必ず煩雑なアライメント作業が伴い、また良い分 析結果を得るためには大型の分光器が必要となり、 装置が大がかりかつ高価になる。

(2)

-427-

本発明は上配実情に鑑みてなされたもので、分 光器を用いずにレーザ光の被長制御を行なうこと ができるレーザ光の放長制御方法を提供すること を目的とする。

[問題点を解決するための手段および作用]

本発明によれば、発振レーザ光の一部を、該レーザ光の液長に対応した位置に干渉縞を形成する 光学手段に入射させ、この干渉縞の位置が目標被 長に関連した位置と一致するように発振レーザ光 の被長を変更する手段を制御するようにしている。 【実施例】

以下、本発明を添付図面を参照して詳細に説明する。

第1図は、本発明の一実施例を示す概略図で、 エキシマレーザ発振器10、エタロン11、ビームス プリッタ12、モニタエタロン系13、信号処理器14、 制御器15、ガスプロセッサ16および調整装置17か ら構成されている。

エキシマレーザ発振器10は案外域の液長を有するレーザ光を発振し、波長週択手段の1つである

(3)

ある。

第2図(a)より、 $\theta$ は  $\tan^{-1}$  ( $r_1$ /x)で得られるので、 $r_1$  の値(干渉縞の位置)を知ることができれば、上記第(1)式に基づいて放長  $\lambda$  を知ることができる。今、 $r_1$  = 0.587  $m_1$  ,  $r_2$  = 1.827  $m_1$  ,  $r_3$  = 2.516  $m_1$  ,  $R_4$  = 3.054  $m_1$  ,  $r_5$  = 3.510  $m_1$  が得られたとすると、 $\nu$  ー ザ光の 放長は上式より  $\lambda$  = 248.35  $\alpha$  m が得られる。

なお、第2図中の13 a に球面レンズの代りにシリンドリカルレンズを使用しても良い。この場合得られる干渉縞は(c)のような平行線のものである。(b)の同心円の干渉縞と(c)の平行線の干渉縞では(c)の方が縞に曲率のない分だけ高い精度で位置検出が可能である。

信号処理器14には予め目積波長が与えられており、信号処理器14は上記のようにして求めた波長と目標放長とを比較し、発振波長が目標放長と一致するように制御器15に制御信号を出力する。

制御器15は、信号処理器14から加えられる信号 に基づいてレーザ光の波長が目録波長に一致する エタロン11は、入射する上配レーザ光のうち、特定の波長のレーザ光のみを通過させる。ビームスプリッタ12は入射するレーザ光を分割し、一方は主用途(例えば縮小投影電光装置)へ、他方はモニタエタロン系13に導く。

モニタエタロン系13は第2図(a)に示すようにレンズ13a、エタロン13bおよびラインイメージセンサ13cから構成され、レンズ13aは入射したレーザ光を拡大し、エタロン13bを介してラインイメージセンサ13cの検出而上に入射させる。この検出而上には、第2図(b)に示すように干渉縞が形成され、ラインイメージセンサ13cはこの干渉縞の位置・間隔の情報を信号処理器14に送

信号処理器14は、まず上配入力情報からレーザ 光の改長を求める。すなわち、エタロン13 b は、 \*\*\*

(4)

ようにガスプロセッサ16または調整装留17若しく はその両方に対して制御をかける。

すなわち、エキシマレーザ発振器10は、その発振媒体であるガスの混合比に応じた波長のレーザ光を発振するが、上記ガスプロセッサ16は混合成分ガスの供給ラインに配置されたマスフローコントローラ・電磁弁等の開閉及びその時間間隔を制御してガス組成を変更し、これによってレーザ光の波長を目標波長に向って移動させる。

また、エタロン11はレーザ光の入射角の変化に 応じて通過するレーザ光の被長を変化させること ができる。調整装置17は、例えばこのエタロン11 を回転させるズテップモータ等からなり、前記信 号処理器14から加えられる信号(パルス信号)に よりエタロン11の回転角を制御し、これによって レーザ光の被長を目標被長に向って移動させる。 なお、エタロン11によって被長制御する場合、上 記回転角制御に限らず、エタロン11のギャップ、 エタロン11のギャップ間のガス圧あるいはガスの 種類を変更するようにしてもよい。

(6)

なお、信号処理器14は必ずしも放長を求める必要はなく、予めモニタエクロン系13に目標放長のレーザ光が入射するときに形成される干海縞の位置を配慮しておき、検出した干渉縞の位置が上記記憶した位置に形成されるように制御信号を出力するようにしてもよい。

また、上記界施例では、ビームスプリッタ12に よってレーザ光を分割し、モニタエタロン系13の レンズ13 a を介してレーザ光を拡大してエタロン 13 b に入射させるようにしたが、これに代えて光 ファイバを用いるようにしてもよい。すなわち、 光ファイバの一端を発掘レーザ光東中に入れ、他 毎端をエタロン13 b の前方所定位置に対峙させる。

一方、モニタエタロン系13の代わりに、マイケルソン干渉計を用いてもよい。第3図に示すようにマイケルソン干渉計20は、2枚のレンズ21・22、2枚の全反射ミラー23・24およびビームスプリッタ 25から構成されている。今、ミラー23・24が点のから等距離にある場合は、ビームスプリッタ 25によって等分されたレーザ光が等しい光路を通過

(7)

波長にピークを有する信号パターンを得るように してもよい。

第4回は色素レーザの被長制御を行なう装置の 実施例を示す。なお、第1回と同一簡所には同じ 番号を付し、その詳細な脱明は省略する。

同図において、色素レーザ31はエキシマレーザ、YAGレーザ等の励起レーザ30によって光ポンピングを行ないレーザ光を発掘する。そして、調整装置32は、制御器15からの信号によりそのレーザ光の発振波長が目標波長となるように色素レーザ31のステージを駆動する。なお、色素レーザ31の 容媒の種類あるいは機度を調整して発振波長を制御するようにしてもよい。

(発明の効果)

した後、結像面否に到着するため、この結像面に は入射光の像がそのまま現れる。 たお、レンズの 倍率によりサイズは変化することがある。

ことで、一方のミラー24を $\Delta$ hだけ接方に移動させると、ミラー24で反射された光は、 $2\Delta$ h cos $\theta$ 分だけ長い光路を通過した接、結像面26に到着するため、この増加分の光路長が放長 $\lambda$ に対して次式、

2 Δ h cos θ = m λ ---------- (2) を満足すれば、この θ の位置では光は強め合い、 結像面26ではこの θ に関連する半径 f, tan θ の 明るい円環を作る。

上記第(2)式からも明らかなように逆に△hを特定の値(1mとかり.1m)に固定した場合、放長人の変化により Ø、つまり円母の半径が変化することになる。

したがって、結像面26にラインイメージセンサを配置し、このラインイメージセンサにより明るい円環を検出するようにすれば、液長の変化を電気的に検出したことになる。

(8)

以上説明したように本発明によれば、分光器を使用する必要がなくなるため装置が簡略になる。また、放長検知部分の装置は従来の大型の分光器に対して価格の面でも1桁ぐらい安価に構成できる。さらに、縮小投影露光用光源として本発明に係るレーザ光を用いると、 観光波長を所定の放長に特度よく固定できるため、フォーカスエラーがなくなり歩留りがよくなる。

#### 4. 図面の簡単な説明

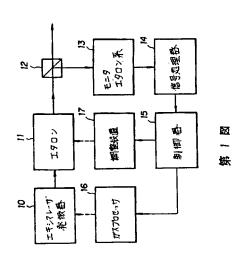
年1 図は、本発明の一実施例を示す長略図、第2 図(a)、(b)および(c)はそれぞれ第1 図のモニタエタロン系を説明するために用いた図、第3 図はマイケルソン干渉計を示す図、第4 図は本発明による他の創御対象レーザを示す既略図、第5 図は従来装置を示す既略図である。

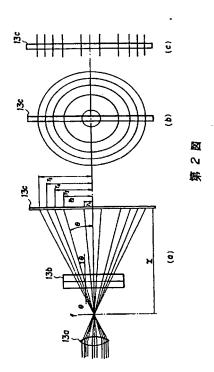
10… エキシマレーザ発掘器、11,13 b … エタロン、12 … ビームスプリッタ、13 … モニタエタロン系、13 a … レンズ、13 c … ラインイメージセンサ、14 … 信号処理器、15 … 制御器、16 … ガスプロセッ

(10)

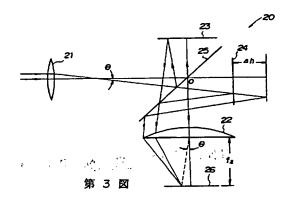
特問昭62-242378(4)

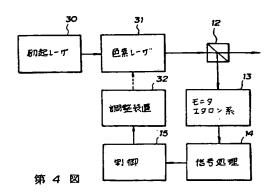
(11)

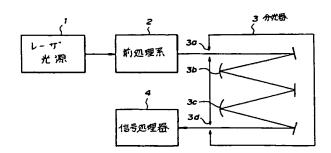




## 特局昭62-242378(5)







第 5 図

THIS PAGE BLANK (USPTO)